

射频等离子干法刻蚀机

所属学校:重庆大学

仪器基本信息				仪 器 编 号		10010183			
				仪器英文名称		RF Plasma Dry Etching Machine			
				所属校内单位		光电工程学院			
				放 置 地 点		A 区微系统研究中心 MEMS 工艺间			
				仪器负责人		尚正国	制造商国别	德国	
				制 造 厂 商		普发拓普公司			
				规 格 型 号		M4L			
				仪 器 原 值		44.83 万元	购置日期	2009.11	
仪器性能信息	主要技术指标		工艺真空度:30mtorr,漏率: < E - 4mTorr/min。						
	主要功能及特色		硅片表面活化、去胶。						
相关科研信息	主要研究方向		电子、通信与自动控制技术;科学研究。						
	在研或曾承担的重大项目		无锡纳微阳极键合、24 所金硅键合、三峡库区环境监测微系统、真空、集成微生物芯片系统研究。						
	学术 论文		近三年利用该仪器作为主要科研手段发表的代表性论文:						
			序号	作者	论文题目	期刊名称	年	卷(期)	起止页
			1	张智海	光栅平动式光调制器的残余应力自测量方法和试验	机械工程学报	2010.4	46(8)	12 - 17
			2	金珠	直梁结构光栅光调制器的机电特性分析与实验	纳米技术与精密工程	2010	1(8)	42 - 46
	3	金珠	基于 SRAM 光栅光调制器阵列控制系统电路的研究	电子学报	2010	38(2)	393 - 398		
专利或奖项									
共享服务信息	收费标准		联盟外		根据具体实验项目协商				
			联盟内		根据具体实验项目协商				
	联系信息		联系人	尚正国	联系电话	65102519	电子邮件	zhengry@cqu.edu.cn	
开放时间		提前预约							